บรรณานุกรม

ชลิตต์ มธุรสมนตรี.” กระบวนการผลิต (Manufacturing Process).” พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.2544.

นิมิต ชมนาวัง, “เทคโนโลยีซินโครตรอนเพื่อการผลิตสิ่งประดิษฐ์จุลภาค.” สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน.2009

ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล,” วิวัฒนาการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนต่อภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1).” หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรม.2010

ปารเมศ ชุติมา. “การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม.” พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. “ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไทย.” 2549.

อลงกต ลิ้มเจริญ. “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการกัดเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์.” วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

A. L. Bogdanov, and S. S. Peredkov, “Use of SU-8 photoresist for very high aspect ratio x-ray lithography,” *Microelectronic Engineering* 53, pp. 493-496, Octorber 2000.

A. Wisitsoraat, S. Mongpraneet, R. Phatthanakun, N. Chomnawang, D. Phokharatkul, V. Patthanasettakul, and A. Tuantranont, "Low-cost and high-resolution x-ray lithography utilizing a lift-off sputtered lead film mask on a Mylar substrate" *J. Micromech. Microeng*.20 (2010) 075026, June 2010.

Bogdanov, A.L., Peredkov, S.S. “ Use of SU-8 photoresist for very high aspect ratio x-ray lithography” (2000) *Microelectronic Engineering*, 53 (1), pp. 493-496.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

C. Pakpum, K. Siangchaew, and P. Limsuwan, “Demonstration of modification from AlF_3 re-deposition to polymer re-deposition on Air Bearing Surface (ABS) Etched Sidewall of Fluorine Based Plasma Etch on Al_2O_3-TiC Substrate”. Advanced Materials Research, vol. 213, pp. 93-97, 2011.

J., Taff, Kashte Y., Spinella-Mamo V., and Paranjape M. "Fabricating Multilevel Su-8 Structures in a Single Photolithographic Step Using Colored Masking Patterns." *Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films*24, no. 3 (2006): 742.

J., Xu, and Bhushan B. "Pole Tip Recession Studies of Thin-Film Rigid Disk Head Sliders. I. Mechanisms of Pole Tip Recession Growth." *Wear*219, no. 1 (1998): 16-29.

Jian, L. K., Casse, B. D. F., Heussler, S. P., Kong, J. R., Saw, B. T., Mahmood, S. b., and Moser, H. O. (2006). Industrial applications of micro/nanofabrication at Singapore Synchrotron Light Source. Journal of Physics: Conference**.** 34: 891–896.

Jian, L., Desta, Y. M., Goettert, J., Bednarzik, M., Loechel, B., Yoonyoung, J., Aigeldinger, G., Singh, V., Ahrens, G., Gruetzner, G., Ruhmann, R., and Degen, R**.** (2003). SU-8 based deep x-ray lithography/LIGA. Proc. of SPIE**.** 4979: 394-401.

L. Singleton, A. Bogdanov, S. Peredkov, O. Wilhelmi, A. Schneider, C. Cremers, S, Megtert, and A. Schmidt, "Deep X-ray lithography with the SU-8 resist". *SPIE* 4343: pp. 182-192, August 2001.

L. Zhou a, K. Kato b, G. Vurens c, F.E. Talke a.” The effect of slider surface texture on flyability and lubricantmigration under near contact conditions.” 2002.

Lee, R.A. "Colourtone Lithography." *Microelectronic Engineering* 61-62 (2002): 105–111.

Limcharoen, A., C. Pakpum, and K. Leksakul. "Wall Angle Control of Reactive Ion Etched Features on a Silicon Substrate." In *Nanoelectronics Conference (INEC),* 2010 3rd *International*, 158-159, 2010.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

N. Fukushima, H. Katai, T. Wada, and Y. Horiike, "High-Rate and Smooth Surface Etching of Al_2O_3-TiC Employing Inductively Coupled Plasma (ICP)," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 35(1), No. 4B, pp. 2512-2515, May 1996.

N. Fukushima, T. Sato, T. Wada, and Y. Horiike, "New reactive ion etching process for HDD slider fabrication" *IEEE Trans. Mag.* vol. 32(5), pp. 3786 - 3788, September 1996.

R. Phatthanakun, P. Songsiriritthigul, P. Klysubun, N. Chomnawang, "Multi-step powder casting and x-ray lithography of SU-8 resist for complicated 3D microstructures" *5th International Conference on ECTI-CON 2008*, vol. 2, pp. 805-808, May 2008.

Schmidt, A., Himmelsbach, G., Lüttge, R., Adam, D., Hoke, F., Schacke, H., Belic, N., (...), Wolf, H.“ High precision mask fabrication for deep X-ray lithography using 40-kV shaped electron beam lithography.”(2001) *Microelectronic Engineering*, 57-58, pp. 761-767.

Shih, W.-P., Cheng, Y., Lin, C.-Y., Hwang, G.-J. “ Low-cost X-ray conformal mask using dry film resist ”(1998) *Microelectronic Engineering*, 40 (1), pp. 43-50

Wisitsora-At, A., Mongpraneet, S., Phatthanakun, R., Chomnawang, N.,Patthanasettakul, V.,Tuantranont, A. “Low cost x-ray lithographic mask based on microsputtered lead film on transparencies.” (2010) *Microelectronic Engineering*, 20-29, pp. 101-150.

Wisitsora-At, A., Mongpraneet, S., Phatthanakun, R., Chomnawang, N.,Patthanasettakul, V.,Tuantranont, A. “Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate.” ,"Journal of Micromechanics and Microengineering, 20 (2010) 075026. (2008Impact Factor 2.233)

Yang-Kuao Kuo, Chuen-Guang Chao, Chi-Yuan Lin. “Analysis of instability line width and white wall createdby the photolithography process”. 2009.Department of Materials Science and Engineering, National Chiao Tung University, 1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu 30049, Taiwan,ROC

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Yi, F., Jin, M., Tang, E., and Xian, D., (1996). " The fabrication of LIGA masks using photolithography and synchrotron radiation lithography ". Microsystem Technologies**.** 3: 7-9.

Zhang Mingsheng_, Liu Bo." Effect of pattern shape on etching wall profile in slider fabrication." 2006.Data Storage Institute, 5 Engineering Drive 1, Singapore 117608, Sigapore

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved